

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成19年3月1日(2007.3.1)

【公表番号】特表2006-518943(P2006-518943A)

【公表日】平成18年8月17日(2006.8.17)

【年通号数】公開・登録公報2006-032

【出願番号】特願2006-503859(P2006-503859)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

B 24 B 37/00 (2006.01)

B 24 B 53/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 2 2 M

B 24 B 37/00 A

B 24 B 53/00 Z

【手続補正書】

【提出日】平成19年1月9日(2007.1.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ケミカルメカニカルプラナリゼーションに適した研磨パッドであって、
60%以上のパッド表面高さ比Rを有する表面高さ確率分布を特徴とする実質的に平坦
な面を有する多孔性パッドコンディショナ表面を含む、研磨パッド。

【請求項2】

Rが70%以上である、請求項1記載の研磨パッド。

【請求項3】

ケミカルメカニカルプラナリゼーションに適した研磨パッドであって、
0.50以下の非対称係数A₁₀を有する非対称表面高さ確率分布を特徴とする多孔性パ
ッドコンディショナ表面を含む、研磨パッド。

【請求項4】

表面高さ確率分布が60%以上のパッド表面高さ比Rを有する、請求項3記載の研磨パ
ッド。

【請求項5】

Rが70%以上である、請求項4記載の研磨パッド。